

RISE 系列

Mini版射频离子源

小型化 为科研试验型应用而生

博顿光电RISE系列-Mini版射频离子源是专门面向科研型试验场景设计的小型化专用离子源产品, 适应于小型真空腔体内的离子束溅射、离子束刻蚀、离子束辅助沉积等工艺应用, 可选配备5cm孔径的多层栅网, 离子束能量范围在50-1200eV灵活可调, 离子束流可达范围150mA, 可选配具有专利技术的中空阴极中和器或射频中和器, 支持超长工艺时间, 热辐射低, 无污染, 使用和维护简易, 满足精密光学、MEMS、半导体、新材料、基因工程等多应用领域的离子束微纳加工科研试验及工业化应用需求。



50-1200eV

离子束能量

150mA

离子束流范围

>1000小时

支持超长工艺

全自主可控

部件与系统自主

结构紧凑, 适应性强

适合各类科研试验用小型工作台
结构兼容性强

匹配多应用场景

匹配多种工艺气体环境, 可适用于离子束辅助镀膜、离子束溅射镀膜、离子束刻蚀及清洗等多种场景

自主可控, 操作便利, 维护简单

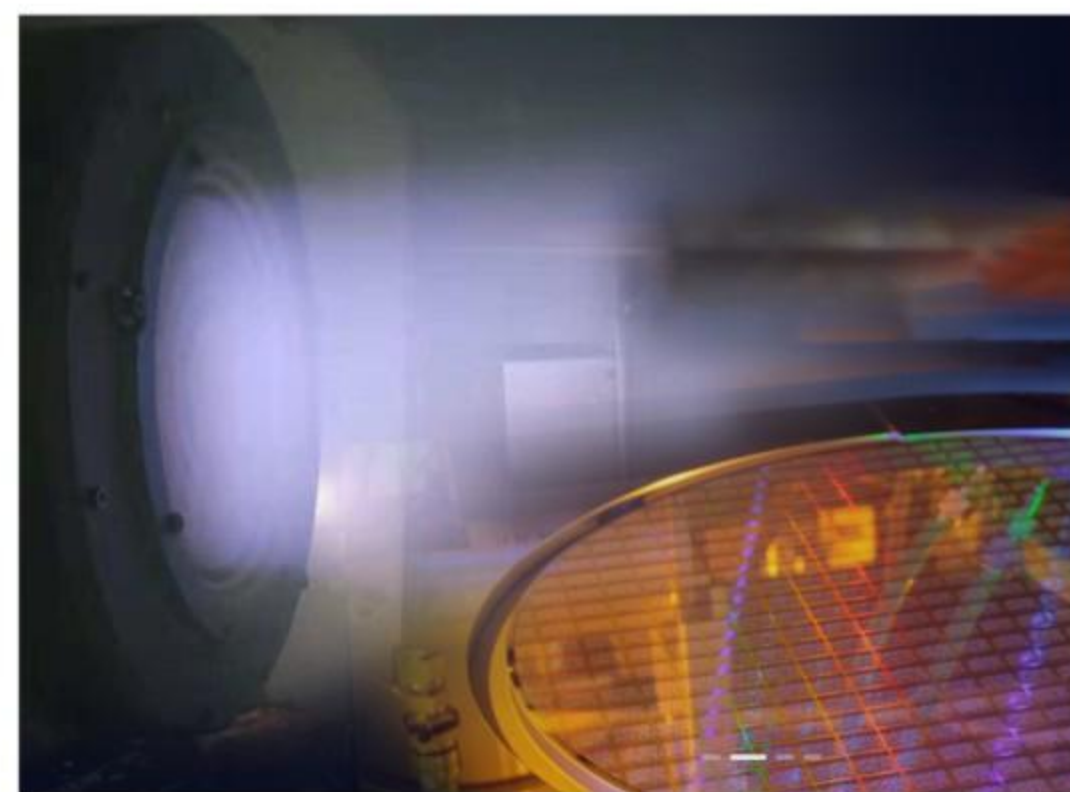
部件与系统全自主可控, 启动快速, 操作灵活, 硬件维护简单

高稳定可靠性

全自主中和器技术, 支持超长工艺, 热辐射低, 无污染, 工艺重复性高



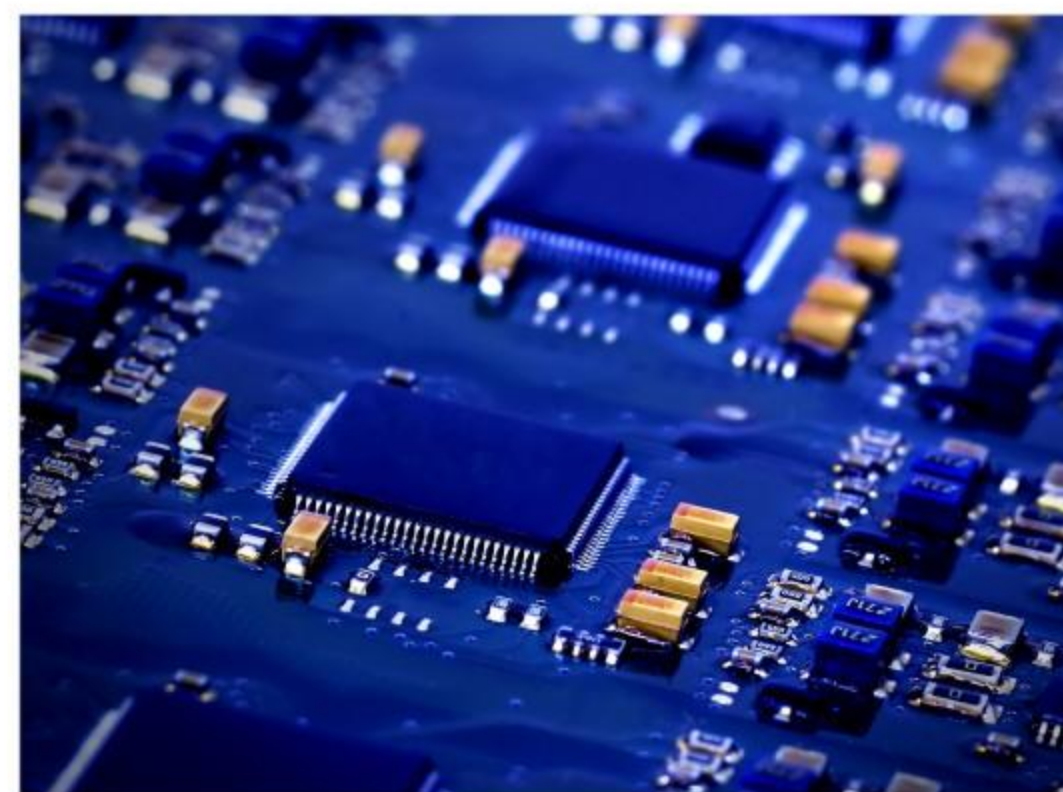
科研试验



离子束微纳加工



新材料



泛半导体

Model	 RISE-Mini版射频离子源
产品型号	IBD-RISE mini
中和器类型	RFC射频阴极中和器、中空阴极中和器
屏栅极电压 (V)	1200
屏栅极电流 (mA)	150
加速极电压 (V)	1000
冷却水	1.5L/min
连续工作时间 (H)	>100
栅网配置	直径:5cm, 多层
气体流量范围	3-50sccm
允许气体类型	氧, 氮, 氩 (其他惰性气体)
控制系统	博顿全自主离子源驱动控制系统
应用方向	
重点面向科研试验的溅射沉积、辅助沉积、离子束刻蚀、表面清洁等应用	
应用领域	
精密光学、MEMS、半导体、新材料、基因工程等多应用领域的离子束微纳加工科研试验及工业化应用	

■ 本资料仅供说明之用，图片及技术规格如有变更，恕不另行通知。

公司简介

“博顿光电”是一家专业从事新型离子源及离子束装备关键技术研发、设计和制造的创新型高科技企业。

博顿光电致力于通过高端离子源核心技术及离子束装备的国产化，在离子束微纳加工核心部件与整机装备细分领域取得突破、成为行业“单打”冠军，打破国外垄断，解决国内在高端离子源及离子束设备领域“用不上”和“用不起”的行业困局，从上游核心部件解决精密光电行业的“卡脖子”问题，有力支撑我国精密光学、光通信、OLED、半导体等战略性新兴产业的创新和发展升级，带动相关产业和行业的能力与价值提升。

博顿光电 | 离子束核心技术引领者

博顿公众号 官方微信号



邮箱: Market@ibdtec.cn

网址: www.ibdtec.cn